



### 一种滴状冷凝金属材料的制备方法

申请(专利)号:CN91100649.4

发明(设计)人:赵起; 李桂芹; 汪国强; 朱晓波; 张殿富; 李松平

摘要:一种滴状冷凝金属材料的制备方法,它是将烷烃及沉积于表面的铬金属层强化固溶于黄铜基体中,形成具有滴状冷凝作用的Cu-Cr-烷烃的合金层。其离子镀膜是在氩气分压为 $1 \sim 1.5 \times 10^{-2}$  mmHg,烷烃气体分压为 $1 \sim 1.5 \times 10^{-2}$  mmHg,向待镀工件施加1500~2000V电压,0.1~0.3A电流,同时使铬靶处于500~600V电压10~15A电流条件下镀膜15~40秒。离子溅射是在氩气分压为 $2 \sim 3 \times 10^{-2}$  mmHg、待镀工件电压1500~2000V、电流0.1~0.3A时,溅射10~15分钟。

主权项:一种用于水蒸汽或其它蒸汽冷凝的滴状冷凝金属材料的制备方法,其特征在于: a、对黄铜待镀工件表面进行抛光处理使之光洁度达到 $\ast 10$ ,再用丙酮清洗,然后放入磁控溅射离子镀炉内; b、氩离子溅射清洗,在炉内其空度为 $4 \sim 8 \times 10^{-5}$  mmHg下充入氩气,使其分压为 $6 \sim 8 \times 10^{-3}$  mmHg,向待镀工件施加1500~2000V电压和0.1~0.3A电充进行氩离子溅射5~10分钟; c、离子镀膜是在氩气分压为 $1 \sim 1.5 \times 10^{-2}$  mmHg,烷烃气体分压为 $1 \sim 1.5 \times 10^{-2}$  mmHg,向待镀工件施加1500~2000V电压,0.1~0.3A电流,同时使铬靶处于500~600V电压,10~15A电流条件下镀膜15~40秒; d、离子溅射是在氩气分压为 $2 \sim 3 \times 10^{-2}$  mmHg,待镀工件电压1500~2000V,电流0.1~0.3A时溅射10~15分钟。

关闭

处长信箱 | 科技处办公室 | 综合科 | 开发部 | 科研科 | 技术转移中心 | 专利中心

Copyright @ 2000-2004 大连理工大学科技处 联系我们 联系管理员: 86961228

地址: 大连市凌工路2号 大连理工大学主楼 邮编: 116023 FAX: 84691725